

**CN2525562Y 英文發明摘要：**

A substrate exposure device includes at least one linear light source and one control system. Wherein, the linear is composed of a few point light sources, and the control system is used to transform a pattern into a time signal to control the state of light and shade of each point light source in different time. Moreover, the scanning light source is controlled by the control system to illuminate the mask on the surface of the substrate and expose the mask.

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl⁷

G03F 7/22

[12] 实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 02201313. X

[45] 授权公告日 2002 年 12 月 11 日

[11] 授权公告号 CN 2525562Y

[22] 申请日 2002.01.08 [21] 申请号 02201313. X

[73] 专利权人 威盛电子股份有限公司

地址 台湾省台北县新店市中正路 533 号 8 楼

[72] 设计人 陈国祚

[74] 专利代理机构 北京集佳专利商标事务所

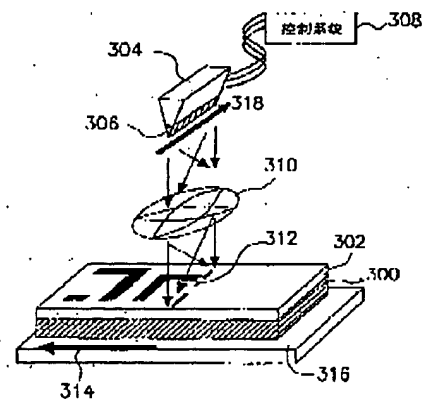
代理人 王学强

权利要求书 2 页 说明书 10 页 附图 4 页

[54] 实用新型名称 基板曝光装置

[57] 摘要

一种基板曝光装置包括至少一线光源与一控制系统。其中,线光源由多个点光源所组成,而控制系统将图案转换为一时间信号以控制每一个点光源在不同时间的明、灭状态,且控制系统控制扫描光源照射于基材表面的光阻,以使得该光阻曝光。



ISSN 1008-4274

知识产权出版社出版

1.一种基板曝光装置，可将一图案转移至一基材表面的一光阻层上，其特征是，该基板曝光装置至少包括：

一光源，该光源配置于距该基材具有该光阻层的表面一特定距离处，该光源包括多个点光源；以及

一扫描控制系统，该扫描控制系统将该图案转换为一依时间变换的信号，以控制每一该些点光源在不同时间的明灭状态，且该控制系统使该基板曝光装置具有扫描功能，可使该光源沿着一扫描路径进行至少一次扫描，使该光阻层曝光。

2.如权利要求1所述的基板曝光装置，其特征是，该基材为印刷电路板（PCB）基材。

3.如权利要求1所述的基板曝光装置，其特征是，该基材为各式封装基材。

4.如权利要求1所述的基板曝光装置，其特征是，该些点光源单排排列以构成一线光源。

5.如权利要求1所述的基板曝光装置，其特征是，该些点光源多排排列以构成多个线光源。